

05.4;12

© 1995

**МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
НА СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ
ПОВЕРХНОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПЛЕНОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СВЕРХПРОВОДНИКОВ**

B. В. Бочков, А. С. Карасев

Экспериментальные данные о поверхностном сопротивлении R_s пленок высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на СВЧ важны как с точки зрения получения сведений о физических механизмах, обусловливающих сверхпроводимость, так и в плане выяснения возможностей технического применения ВТСП в линейных и нелинейных СВЧ устройствах и разработки необходимых технологических процессов. Относительно высокая температура (выше 77 К) и малое значение наблюдаемого сопротивления определяют трудности измерений. В настоящее время основным используемым на практике является метод объемного резонатора, в котором R_s находят из измеренного значения добротности СВЧ резонатора, содержащего сверхпроводящую пленку. Применяют три разновидности резонаторов: полый цилиндрический объемный с типом колебаний H_{01n} , в котором один из торцевых экранов из ВТСП пленки [1,2]; диэлектрический резонатор с одним из торцевых экранов из ВТСП пленки [3,4]; плоскопараллельный резонатор, образованный двумя пленками ВТСП с тонким диэлектриком между ними, работающий на типе колебаний TEM_{mn} [5,6]. Всем вариантам присущи такие недостатки, как необходимость иметь пленки большой площади, сложность конструкции и требование механической прецизионности, а также малую чувствительность, поскольку вклад в потери резонатора металлических поверхностей и диэлектрика оказывается больше, чем потери в сверхпроводящей пленке.

Ниже описан простой новый метод измерений поверхностного сопротивления, исключающий перечисленные недостатки. Метод базируется на использовании резонансных свойств образца, размещенного в поперечном сечении прямоугольного волновода и измерениях коэффициента передачи на резонансной частоте. Регистрируемый эффект целиком определяется проводимостью образца ВТСП, благодаря чему диапазон измерений расширяется в область

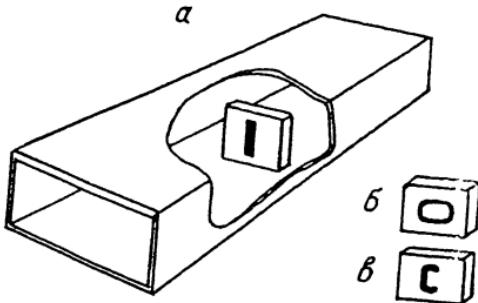


Рис. 1. Конструкция измерительного устройства. а — эскиз измерительной камеры, б — возможные конфигурации образцов.

малых значений R_s . Эскиз измерительной камеры показан на рис. 1, а. Она образована отрезком прямоугольного волновода стандартного сечения, в котором находится диэлектрическая подложка с нанесенной пленкой. Ширина подложки меньше ширины волновода. ВТСП пленка может иметь конфигурацию в виде узкой полоски, ориентированной вдоль поля E волновода, либо в виде узкого кольца или полутора кольца (рис. 1 б, в). ВТСП пленка является проводящей неоднородностью, включенной в плоскость поперечного сечения волновода. Всем конфигурациям пленок соответствует эквивалентная схема в виде последовательного L, C, R контура с резонансной частотой, определяемой размерами проводников и диэлектрической подложки [7]. Если волновод возбуждается генератором с внутренним сопротивлением W и нагружен на согласованную нагрузку $R_h = W$, то эквивалентная схема устройства, в отличие от [8], представима рис. 2 а, а частотная характеристика коэффициента передачи, определяемого отношением амплитуд прошедшей $U_{\text{пр}}$ и падающей $U_{\text{пад}}$ волн, $K = U_{\text{пр}}/U_{\text{пад}}$, имеет вид, показанный на рис. 2, б. На резонансной частоте f_0 коэффициент

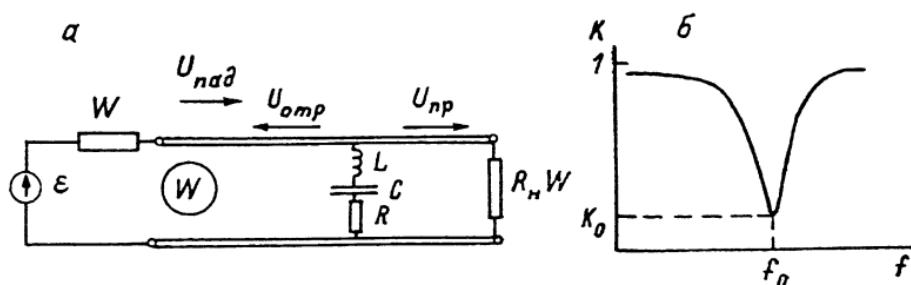


Рис. 2. Схема измерений. а — электрическая эквивалентная схема, б — типовая частотная характеристика.

передачи имеет значение K_0 ,

$$K_0 = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \frac{W}{R}}. \quad (1)$$

Между поверхностным сопротивлением пленки R_s и полным сопротивлением контура R имеется линейная связь

$$R = \gamma R_s, \quad (2)$$

где γ — коэффициент, характеризующий распределение тока по проводящей пленке. Таким образом, измерив коэффициент передачи K_0 и воспользовавшись соотношениями (1) и (2), находим

$$R_s = \frac{1}{\gamma} \frac{W}{2} \frac{K_0}{1 - K_0}. \quad (3)$$

При $K_0 \ll 1$ из (3) имеем линейную связь R_s и K_0

$$R_s \approx \frac{1}{\gamma} \frac{W}{2} K_0, \quad (4)$$

что дает возможность измерения малых значений R_s с погрешностью, определяемой погрешностью измерения K_0 . Значение коэффициента $W/2\gamma$ может быть рассчитано теоретически, однако проще определить его экспериментально, изголовив калибровочный образец из материала с известным R_s (медь, серебро) на подложке с такими же геометрическими размерами. Таким образом, преимущества предлагаемого способа заключаются в конструктивной простоте измерительного устройства, малых размерах ВТСП пленки и возможности измерения малых значений R_s .

Описанным способом были выполнены измерения поверхностного сопротивления пленок из Ag и YBaCuO (1,2,3) в трехсанитметровом диапазоне длии волн. Использовался волновод стандартного сечения 10×23 мм и подложки NdGaO_3 размером 5×10 мм, толщиной 0.6 мм. Размеры пленок 5.8×0.2 мм. ВТСП пленка выращивалась методом лазерного распыления и имела толщину ~ 100 А. Для измерения коэффициента передачи использовался прибор типа Р2-61. Измерительная камера с широкополосным волноводно-коаксиальным переходом на конце была герметизирована и погружалась в жидкий азот. Используемая для контроля температуры термопара размещалась внутри волновода в непосредственной близости от образца. Температурная зависимость снималась в ходе охлаждения (или разогрева) камеры без установления стационарных режимов в промежуточных точках между температурой азота и

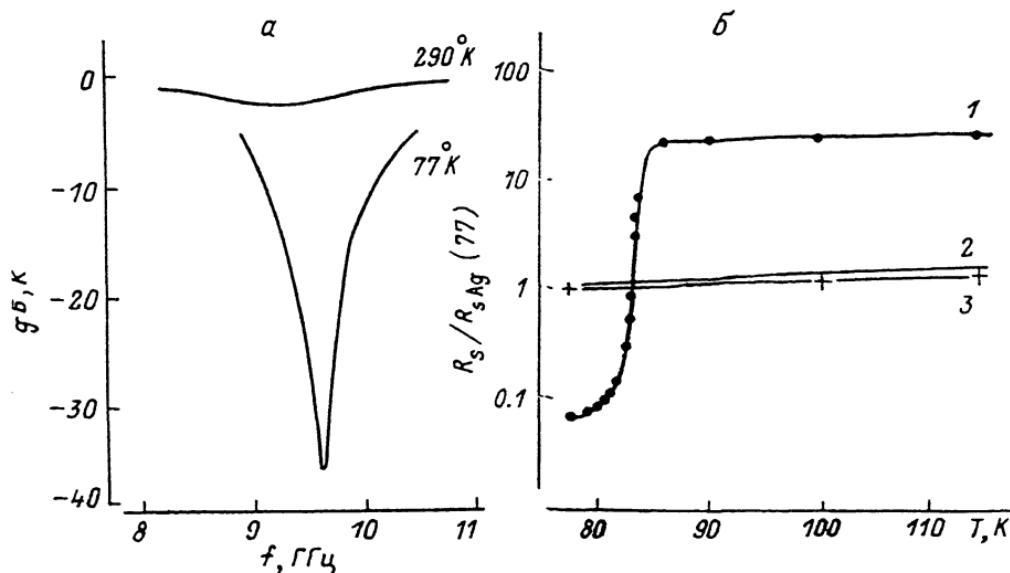


Рис. 3. Экспериментальные зависимости. а — частотные характеристики образца YBaCuO при различных температурах; б — температурные зависимости поверхностного сопротивления: 1 — YBaCuO, 2 — Ag, 3 — расчетная для Ag.

комнатной. Поэтому данные контроля температуры следует рассматривать как оценочные. Экспериментальные результаты приведены на рис. 3. На рис. 3, а показаны частотные характеристики, наблюдавшиеся на экране Р2-61 при измерениях ВТСП образца при различных температурах, а на рис. 3, б — зависимости от температуры поверхности сопротивления, нормированные к сопротивлению Ag при 77 К. Как видно, в образце ВТСП наблюдался переход в сверхпроводящее состояние при температуре около 83 К, а минимальное значение сопротивления R_s было в 14 раз меньше, чем у серебра. Кривая 3 представляет расчетную температурную зависимость $R_s(T)$ серебра. При изменении температуры от 77 до 300 К расчетное изменение R_s серебра составляет 2.37 раза, а полученное в эксперименте 1.89. Причиной имеющегося расхождения может быть то, что расчет был проведен на основе данных, относящихся к плавленому серебру.

Разработан простой метод измерения поверхностного сопротивления на СВЧ пленок высокотемпературных сверхпроводников. Авторы благодарят сотрудников ФТИ им. А.Ф. Иоффе И.А. Линийчука и В.Н. Боревича за изготовление образцов. Работа выполнена в рамках программы "Межсоединения", тема № 90528.

Список литературы

- [1] Вендиш О.Г., Гайдуков М.М. и др. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 24. С. 2209.
- [2] Klein N., Mueller G. et al. // Appl. Phys. Lett. 1989. V. 54. N 8. P. 757.
- [3] Hakki B.W., Coleman P.D. // IRE Trans. on MTT. 1960. V. MTT-8. N 4. P. 402.
- [4] Mage J.C., Marcilhac B. et al. // Proc. of 23-nd European Microwave Conference. Spain, sept. 1993.
- [5] Taber R.C. // Rev. Sci. Instrum. 1991. V. 61. P. 2200.
- [6] Белоев Р.К., Варганов А.В. и др. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. В. 11. С. 1.
- [7] Гупта Л., Гардж Р., Чадха Р. // Машинное проектирование СВЧ устройств. М., 1987. 432 с.
- [8] Miranda F.A., Gordon W.L. et al. // J. Appl. Phys. 1991. V. 70. N 10. P. 5450.

Санкт-Петербургский
государственный технический
университет

Поступило в Редакцию
24 сентября 1994 г.
